

オーガナイズドセッション

「溶射の物理を考える」

－新しい溶射プロセスの試みと成膜挙動－

オーガナイザ：納富 啓（三菱重工業株）
福本 昌宏（豊橋技術科学大学）

[趣 旨]

溶融粒子の積層を基本構成要素とする通常の溶射プロセスは、未だ膜形成の支配因子が特定されず、プロセス因子と膜特性との関連が不明である、またプロセス制御が困難であるなどの問題を残している。溶射プロセスを上流から下流への素過程に分け、各過程での支配因子を抽出するとともに、素過程相互の関連づけにより、溶射プロセス全体像の把握・解明を試みる。またこれを基に、新成膜プロセスへの展望を模索する。

○一般講演

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (1) プラズマ解析 | 鈴木正昭（東京工業大学） |
| (2) プラズマ内粒子挙動 | 納富 啓（三菱重工（株）） |
| (3) 粒子／雰囲気気間の反応 | 恒川好樹（豊田工業大学） |
| (4) 粒子偏平理論 | 平田好則（大阪大学） |
| (5) ” | 深沼博隆（プラズマ技研工業（株）） |
| (6) 液滴モデル実験 | 天田重庚（群馬大学） |
| (7) 粒子偏平観察 | 福本昌宏（豊橋技術科学大学） |
| (8) 皮膜形成過程 | 黒田聖治（金属材料技術研究所） |

○総合討論

コメンテーター

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) HVOF溶射 | 谷 和美（トーカロ（株）） |
| (2) ETLレーザー溶射 | 塚本孝一（電子技術総合研究所） |
| (3) レールガン溶射 | 薄葉 州（物質工学工業技術研究所） |
| (4) 電熱爆発溶射 | 田村英樹（東京工業大学） |